

HPN1 FORM

ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

Lurrunketa teknologia	PVD HiPIMS
Estalduraren materiala	AlTiCrN oinarrituta
Estalduraren lodiera	3-5 µm
Kolorea	Beltz morea
Gogortasuna	3700HV
Deposizio tenperatura	450-480°C
Lan. tenperatura max.	1100°C

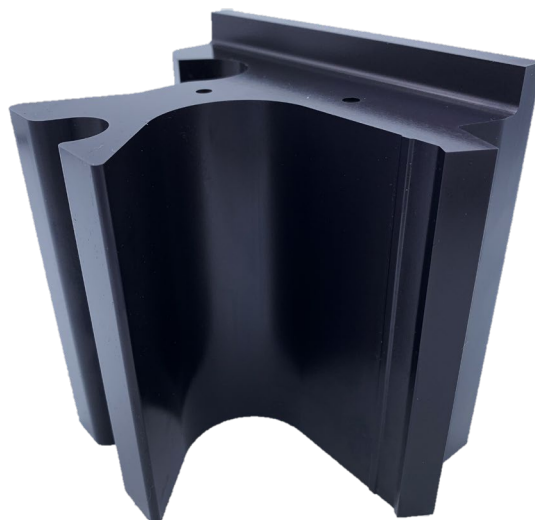


Estalduraren ezaugarriak

- HiPIMS) dentsitate eta trinkotasun altua.
- (HiPIMS) zimurtasun baxua.
- Gogortasun oso altua.
- Erresistentzia itsaskorra.
- Tenperaturaren eta neke termikoaren aurkako erresistentzia altua.

Aplikazio industrialak

HPN1 HiPIMS teknologia bidez ezarritako gainestaldura bat da, baldintza zorrotzenetan lan egiteko diseinatuta. Hotzeko eta beroko lanetarako matrizerian erabiltzen da zein aluminioko eta aleazioen injekzio-moldeetarako.



 **FLUBETECH**
SURFACE ENGINEERING

RG-TCHP1